Національна академія наук України
Міністерство освіти та науки України
Наукова рада з проблеми "Фізика напівпровідників
та напівпровідникові пристрої" при Відділенні фізики і астрономії
Національної академії наук України
Українське фізичне товариство
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Інститут оптоелектроніки

## VI УКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ УНКФН-6

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Чернівці, Україна 30 вересня – 4 жовтня 2013

## ВПЛИВ γ-ОПРОМІНЕНЯ НА МЕХАНІЗМ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДУ В СТРУКТУРАХ Мо/n-Si

Оліх О.Я.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет

Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13, e-mail olikh@univ.kiev.ua

Діоди Шотки (ДШ) широко використовуються у швидкісних логічних схемах, мікро- та оптоелектронних пристроях тощо, які нерідко функціонують за умов радіаційного опромінення. Як наслідок, питанню взаємодії радіації та бар'єрних напівпровідникових структур приділяється значна увага. Зокрема виявлено, що при опромінені у-квантами можуть спостерігатися немонотонні зміни параметрів ДШ [1,2], проте, на жаль, детально причини такого ефекту в літературі не розглянуто. Дана робота присвячена аналізу механізмів перенесення заряду в ДШ, де спостерігаються немонотонні змінами параметрів внаслідок у-опромінення.

Для досліджень використовувалися структури, які складалися з підкладки n+-Si:Sb (КЭС 0,01) товщиною 250 мкм та епітаксійного шару n-Si:P (концентрація носіїв  $(1,1\div1,2)\cdot10^{23}$  м $^{-3}$ , товщина  $\sim$ 0,2 мкм), на поверхні якого створено молібденовий контакт Шотки діаметром 2 мм. В роботі проводилося вимірювання вольт-амперних характеристик (ВАХ) в діапазоні температур 120-320 К для структур, опромінених  $\gamma$ -квантами  $^{60}$ Со з поглинутою дозою  $D_{\gamma}$  0, 10 та 100 кГр.

Прямі гілки ВАХ апроксимувалися виразом

$$I = I_S \exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{qV}{kT}\right)\right] =$$

$$= AA^*T^2 \exp\left(-\frac{q\Phi_b}{kT}\right) \exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{qV}{kT}\right)\right],$$
(1)

де  $I_{\rm S}$  – струм насичення, n – фактор неідеальності, A - площа контакту,  $A^*$  - стала Річардсона,  $\Phi_b$  – висота бар'єру. Визначені температурні залежності  $I_{\rm S}$ , n та  $\Phi_b$  наведено на рис.1, з якого видно що зі збільшенням  $D_\gamma$  зміни параметрів дійсно немонотонні.

Аналіз показав, що для структур з  $D_{\gamma}$ =10 кГр (при T>260 K) та  $D_{\gamma}$ =0 кГр висота бар'єру та величина ( $n^{-1}$ -1) лінійно залежать від оберненої температури, що є характерним для випадку проходження струму за рахунок термоемісійних процесів через неоднорідний бар'єр [3]. Крім того, визначене в рамках такої моделі струмопереносу значення  $A^*$  (1,12÷1,22 A·cm<sup>-2</sup> K<sup>-2</sup>) добре співпадає з літературними даними.

Для структур з  $D_\gamma$ =10 кГр (при T<240 K) та  $D_\gamma$ =100 кГр (при T= =110÷130 K) експериментальні дані добре описуються виразами

$$n = (E_{00}/kT) \coth[E_{00}/kT],$$
 (2)

$$I_S = I_{S0} \exp(\chi T), \tag{3}$$

тобто у цьому випадку основним механізмом зарядо-переносу  $\epsilon$  стимулюване фононами тунелювання по ланцюжку глибоких рівнів, пов'язаних з дефектами у зарядженому шарі [4].

Водночас, для структур  $D_{\gamma}$ =100 кГр при T>260 К перенесення заряду відбувається завдяки термоемісії через однорідний бар'єр, про що свідчить співпадіння кількісних характеристих змін  $\Phi_b$  та ширина забороненої зони, а також температурна залежність фактору неідеальності, яка описується виразом

$$n = 1 + (T_0 / T). (4)$$

При T=140÷250 К для цих структур суттєвими є процеси тунелювання, що підтверджується слабкою залежністю  $I_{\rm S}$  від температури, а також лінійністю польової залежності зворотнього струму в координатах Фаулера-Нордгейма.

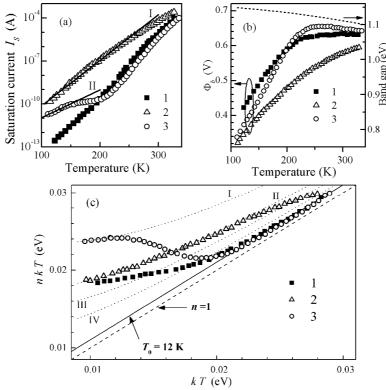


Рис. 1. Температурні залежності струму насичення (а), висоти бар'єру (b) і фактору неідеальності (c). D $\gamma$ , к $\Gamma$ p: 0 (1), 10 (2), 100 (3). Точки – експеримент, лінії – розрахунок для (а) за формулою (3) ( $\chi$ , 10<sup>-3</sup> K<sup>-1</sup>: 73 (I), 42 (II),  $I_{S0}$ , A: 5·10<sup>-14</sup> (I), 1.3·10<sup>-13</sup> (II)); для (b) ширини забороненої зони, для (c) пуктир за формулою (2) ( $E_{00}$ , меВ: 23.5 (I), 17.8 (II), 15 (III), 12 (IV)), суцільна за формулою (4) ( $T_0$ =12 K)

Отже, показано, що не монотонність дозових залежностей параметрів ДШ при у-опромінення викликана зміною механізмів перенесення заряду. На нашу думку, подібні процеси пов'язані з утворенням радіаційних дефектів в області просторового заряду на початкових етапах опромінення і їх гетеруванням на неоднорідностях контакту при збільшенні поглинутої дози.

- 1. Karatas S., Turut A. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 2006. **566**. P.584.
- 2. Umana G.A., Membreno et.al. // J. Appl. Phys. 2007. **101**. P.054511.
- 3. Werner J.H., Guttler H.H. // J. Appl. Phys. 1991. **69**. P.1522.
- 4. Евстропов В.В., Жиляев Ю.В., Джумаева М., // ФТП. 1997. **31**. С.152.